

**NEYCO**

## **Dépôt de couches anti-charge rinçables sous vide primaire**

Isabelle RICHARDT<sup>1</sup>, Frédéric HAMOUDA<sup>2</sup> et Abdelhanin AASSIME<sup>2</sup>

<sup>1</sup>NEYCO, Vanves, FRANCE

<sup>2</sup>IEF, Orsay, FRANCE

Le dépôt de couches conductrices permettant à l'issue de l'observation MEB de récupérer l'échantillon intact après un simple rinçage à l'eau est aujourd'hui une technologie aboutie.

Pour se faire on utilise un sputtering de laboratoire, sous vide primaire, avec une seule et même cible et un même environnement gazeux on effectue le dépôt en un run.

Au cours du dépôt (au bout de quelques secondes) on ouvre le shutter pour modifier la composition de la couche.

La couche ainsi réalisée est rinçable, au niveau de son interface avec le substrat, et conductrice dans toute son épaisseur.

L'échantillon peut être observé dans les jours ou mêmes les semaines qui suivent et simplement retourner à son état initial après rinçage à l'eau (20°C à 60°C selon adhérence).

Le process permet un contrôle absolument non destructif d'échantillons peu ou pas assez conducteurs.